U.D.C. 621.385.833

日立HU-9型高性能電子顯微鏡 只野文哉* 大沼嘉 鄎**

Hitachi Type HU-9 Universal Electron Microscope

By Bun'ya Tadano, D.S.E. Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd. Yoshirō Ōnuma Taga Works, Hitachi, Ltd.

Abstract

This is a report of how the writers established a lens system which is compensated for chromatic aberration by using objective and projection lenses under strong excitation, and how brought it in the field of utility as a new product, Type HU–9 electron microscope.

In this electron microscope consisting of a three lens system, magnification range continuous from 800 to 15,000 times can be covered. Both the axial chromatic aberration and the spherical aberration are reduced to a fractional value and the chromatic field aberration to one tenth of the value that had been taken as common. This has accorded the instrument one salient feature that it suffers only a negligible decrease in its resolution for image under the comparatively large variations of high tension from the source.

An electron diffraction chamber is provided between the intermediate lens and the projection lens, and by a proper selective use of the objective, intermediate, and projection lenses the instrument affords three ways of observation, i.e. bright field, dark field and shadow image, and as viewed in terms of electron diffraction, affords four types of usage, i.e. electron diffraction of selected variable areas of the specimen (microdiffraction), high resolution election diffraction, shadow microdiffraction, and Kossel-Möllenstedt diffraction. The resolving power in bright field image is $2\sim 3 m\mu$. The resolving index of microdiffraction is 2×10^{-4} , and that of high resolution electron diffraction is 1×10^{-5} .

The writers who shared a major portion of researching and engineering efforts in the development of this new electron microscope, are inviting in the end the readers' sincere comment on its highly versatile function.

[I] 緒 言

電子顕微鏡の像拡大に使われている電子レンズは大き い収差をもつているので,使用上やかましい制限がある。 たとえば対物レンズの球面収差による像の"ぼけ"を減 らすためには試料を照射する電子線の開き角を 10⁻³~ 10⁻⁴ rad.,(光学顕微鏡の場合は 1 rad.,程度)としなけ

- * 日立製作所中央研究所 (工博)
- ** 日立製作所多賀工場

*

ればならない。又色収差に至つては、電子加速用の高圧 電源の電圧変動を 0.01% ぐらいに安定化しないと像の "ぼけ"が目立つてくる。こんにち電子顕微鏡の実用性 が認められながらも、研究室的存在から出て広く普及さ れないのは、高価であるということのほかに、デリケー トな機械だということがその理由になつている。

0.01% の電圧変動は加速電圧 50 kV に対して 5V で ある。レンズ励磁電流の許容変動⁽¹⁾は加速電圧の約半分 であるから 0.005% に安定化せねばならない。このよう

- 51 -----

630 昭和29年3月

3 月

立 評 論

日

第36巻第3号

な高度の安定を必要とした装置は,電子顕微鏡出現以前 にはあまり無かつたから,多くの研究者がその解決にか なりの力を注いだ。

一方,電子レンズの色収差を補正して電源に対する苛 酷な要求を緩和し,電子顕微鏡像の質的向上を図ろうと する配慮がなされたのは当然である。電子レンズには軸 上の色収差と軸外の色収差の二つがありZworykin⁽²⁾ら は軸外色収差補償の可能性に就いてはじめて言及してい る。我々は1950年のはじめに、磁界レンズの色収差の 研究に着手したが,その結果対物レンズ及び投射レンズ を最小焦点距離近くで動作させ,投射レンズ磁極の孔径 に対する間隔の比を適当にとれば、軸外色収差が完全に 補償できると同時に, 軸上色収差, 球面収差の少ない優 れたレンズ系が得られることを実験的に見出し,その理 論を確立することができた。我々は新しいレンズ系を色 収差補償レンズとよんでいるが, 従来製品化されていた 電子レンズ系に対し、軸外色収差係数は約 1/10、軸上 色収差係数は約1/3, 球面収差係数は約1/5 であつて, 加速電圧が1%(従来の100倍)変動してもなお5mμ の分解能(3)が得られるという結果を得た。最近オランダ Delft 大学の Le Poole 教授の私信(4)によれば, 我々と



- 第1図 対物レンズ (*IN*/√φ~19) として使つた 時のカーボンブラック粒子周辺に現われた フレネルフリンヂ (3本出ている軸上より 3μ離れた位置)
- Fig.1. Fresnel Fringes of Carbon Black with a Strong Objective Field $(IN/\sqrt{\phi} \simeq 19)$

巻数) は加速電圧を E(V) としたとき, $IN/\sqrt{E}\simeq19$ であつて普通レンズより数十%大きくすれば足りること を知つた。また軸外色収差による解像度の低下は, 加速 電圧の変動, 軸調整不良などの実用的な面からは決して 無視し得ないことが明らかとなり, 1951 年 3 月色収差

略々同様なレンズ系で実験した結果,加速電圧 75 kV に 於て電圧変動 1% に対し,像回転角は 20°(軸外色収差 係数 0.15)で 8 m μ の分解能が得られたといつている。

軸外色収差の補償法が,具体的実験的でないにせよそ の可能性が指摘(2)されていたにかいわらず、実現をみな かつたのは何故であろうか。その第一は, 対物レンズの 倍率色収差係数の0となるレンズ励磁アンペア巻数が, これまでの常識では普通レンズの 2.5~3 倍(5)になつて 設計製作が容易でないと考えられたこと, 第二はこのよ うな強いレンズでは試料が対物レンズの中に深く入るた め,所謂試料前磁場の影響(6)で試料照射角が大きくな り,球面収差(試料照射角の3乗に比例)や軸上色収差 (試料照射角に比例)が著増して、例え軸外色収差の補 償に成功したとしても使いものにならないと考え(7)られ たこと, 第三は軸外色収差を補償しても何等得るところ がないとしていたことなどである。 我々は 1949~1950 に磁界型電子レンズの焦点距離, 像回転角, 主面位置等 の測定と非点収差の研究を行つていたが、対物レンズの 最小焦点距離近くに於ても、予想に反して第1図の如く 数本のフレネルフリンヂが現われることを見出したので 前に述べた第二の疑懼である試料前磁場の影響を再検討 したところ,電子顕微鏡像に対して悪影響どころか,見 方によつては好影響さえあるという逆の結果^(E)が得られ た。それに力を得て軸外色収差の実験的研究を行い、対 物レンズの倍率色収差0のアンペア巻数 IN (アンペア 補償レンズ系の特許申請⁽⁹⁾を行つた。軸外色収差の補償 は、3段レンズ系でも、中間レンズを倍率縮小レンズと して使えば実現可能⁽¹⁰⁾で、表題の HU-9 型電子顕微鏡 は、倍率可変、制限視野廻折等を考慮し、3段レンズ色 収差補償レンズ系として設計した。

HU-9 型電子顕微鏡の製作目標は、上述の色収差補償 法の実現にあつたが、倍率を変えるために投射レンズに Revolver⁽¹¹⁾を使つたことから、高性能電子廻折装置と しての設計が容易になつて、高分解能電子廻折、陰影顕 微廻折、Kossel-Möllenstedt 廻折(K-M 廻折)、陰影 顕微鏡の4つの使用法が更に加わることゝなつた。

以下 HU-9 型電子顕微鏡の原理,構造の大要と使用結 果に就いて詳述する。

[II] 磁界型電子レンズの色収差とその補償

電子顕微鏡の色収差は,球面収差及び非点収差と共に, 解像度に対して重要な役割を占めている。この色収差 は,加速電圧及びレンズ励磁電流の変動及び試料透過の 際の電子エネルギーの損失によるものと考えられる。

色収差には軸上色収差と軸外色収差とがある。軸上色 収差はレンズを強励磁で使うほど小さくなるが完全に色 消しとすることは不可能⁽¹²⁾であるとされている。軸外 色収差は,動径方向の偏位(ずれ)を生ずる倍率色収差と, 回転方向のずれを生ずる回転色収差の二つに分けられ る。

対物レンズでも,投射レンズでも弱い励磁では電子速 度が増す(加速電圧が高くなる)と倍率は小さくなるが, 或る励磁の強さでは速度が少しぐらい変つても倍率は不 変となり,更に強い励磁では速度が増すと倍率が逆に大 きくなる。即ち倍率色収差の0になる特定の励磁アンペ ア巻数が存在する。これに反し回転方向の像のずれの量 は,励磁の強さの増加と共に単調に大きくなり,符号を 変えたり0となることはないが,2つのレンズを逆極性 につなげば,合成の回転方向のずれは相殺できる。従つ て対物投射両レンズを適当な励磁条件で組合せれば,倍 率回転を含めた合成の軸外色収差を0とすることが可能 である。レンズが2箇以上の場合も,また3段レンズで 中間レンズを倍率縮小レンズとして使つた場合も同様で ある。

(1) 軸上色収差⁽¹³⁾

幾何光学的に見た軸上色収差は、電子速度の変化に対 応する物面の位置変化によつて生ずるものと解釈され る。即ち像面に共軛な物面 Z_f の変位を $4Z_f$ とすると、 ぼけ円の半径 δ_{Fa} は

 $\delta_{Fa} = |\alpha \cdot \Delta Z_f|$(1) 但し α : 物点に於ける電子線の傾き



631

隔 2.25 mm の対物レンズでは,弱いレンズとして用い

と書かれ、一方

但し CFa: 軸上色収差係数

△ \$ / \$: 電子速度(V)の変動 より軸上色収差係数 C_{Fa}は

となる。(4) 式の磁場を仮定すれば

$$H(Z) = \frac{H_0}{1 + (Z/a)^2}, \quad w^2 = 1 + \frac{e}{8m\phi} H_0^2 a^2 ...(4)$$

但し e/m : 電子の比電荷
 H_0 : レンズ中心磁場の強さ
 a : 半減幅
 $C_{Fa} = \frac{a\pi(w^2 - 1)}{2w^3 \sin^2 \pi/w}......(5)$

となる。片桐氏は ΔZ_f をフレネルフリンヂから求め, 実験的に $\Delta Z_f \cdot \Delta \phi / \phi$ を出して(5)式と比較したが, 第2 図の如く両者はよく一致している。この際 aは焦点距離 の実験から求めた値を用い, w は

$$\frac{IN}{\sqrt{\phi}} = 16.81\sqrt{w^2 - 1} \left(\frac{7\sqrt{\gamma}2}{\sqrt{Volt}}\right) \dots (6)$$

で換算している。

この実験から, a が小さいほど(磁極の孔径, 間隔の小さいほど)また強いレンズとして用いるほど収差係数 CFa が小さくなることが判つた。例えば孔径 5 mmø, 間 た場合 $(IN/\sqrt{\phi}=8.8)$ C_{Fa} は 3~4mm, 強いレンズ として用いた場合 $(IN/\sqrt{\phi}=19)$ では C_{Fa} は 0.7~ 1mm に減少する。

(2) 軸外色収差の実験(14)

軸外色収差は普通の明視野像の場合,カーボンブラッ ク等の粒子を試料とし電圧或いは電流変化を加えれば容 易に観察できる。対物,投射両レンズに就いては電圧, 電流の両方法で,中間レンズに就いては電流法で実験的 に係数を求めた。電圧法で対物レンズの係数を求めると きは投射レンズを仂かせず,投射レンズの収差を求める 時には試料を投射レンズの上方に置いた。中間レンズの 場合には他レンズの影響が入るので電流法に限られた。

対物レンズの励磁の強さを次第に変え,加速電源に $4\phi/\phi=2.35\times10^{-2}$ の交流 50~ 電圧変動を与えた場合の 像の動きを示したものが第3図(次頁参照)である。試 料はカーボンブラックである。弱いレンズ($IN/\sqrt{\phi}=$ 11.7)の状態では,電圧変動による像の動きは第3図(a) の如くで,動径に対するずれの方向の傾角は 124°であ り,倍率色収差係数は負である。強いレンズ($IN/\sqrt{\phi}$ =18.7)では第3図(b)に見られるように像のずれは回 転方向のみで傾角は 90°,倍率色収差は0である。更に 強いレンズ($IN/\sqrt{\phi}=25.5$)では第3図(c)に見られ るように,弱いレンズにくらべて動径方向(倍率)の動 きが正反対となり,ずれの傾角は 42°,倍率色収差は正 になる。

---- 53 -----



- (b) $IN/\sqrt{\phi} = 18.7$ (c) $IN/\sqrt{\phi} = 25.5$
- Fig.3. Electron Micrograph of Carbon Black Showing Excessive Displacement due to Chromatic Field Aberration Voltage Variation $(\Delta \phi / \phi = 2.35 \times 10^{-2})$



Fig.5. Coefficient of Chromatic Difference of Rotation for $IN/\sqrt{\phi}$

これらの写真から励磁の強さと倍率色収差係数(第4 図)及び回転色収差係数(第5図)の関係が求められる。 即ち対物レンズの倍率色収差係数は、レンズの弱いとき 約 -1でレンズの強さと共に増し、 $IN/\sqrt{\rho}$ が約19で 0を通り、正になつた。投射レンズの場合も同様な傾向 で、係数が0になる $IN/\sqrt{\rho}$ は磁極間隔と孔径の比に よつて第6図のように変り、12~18の値をとつた。中間 レンズ(倍率縮小に使用)では係数は常に正で、レンズ を強くし、倍率の縮小を行うほど係数が大きくなること が認められた。

回転色収差係数に就いては、中間,投射両レンズに対して *IN*/√ → と直線関係が得られ,対物レンズの係数 はレンズの強さが増すに従つて飽和の傾向を示すことが みられた。

(3) 軸外色収差の計算⁽¹⁵⁾

回転色収差の計算は軌道方程式から求めても,像の回 転角を微分しても同じ結果



- 第6図 投射レンズの倍率色收差係数が0となる $IN/\sqrt{\phi}$ とレンズ寸法 h/dの関係
- Fig. 6. $h/d-IN/\sqrt{\phi}$ Curve of Projector (Coefficient of Chromatic Difference of Magnification in Zena)

倍率縮小率 R のみの函数となり,

で表わされる。中間レンズを薄いレンズとすれば(10)式 は



と書くことができる。こゝに k は 中間 レンズの対物, 投 射両 レンズに対する相対位置並びに レンズ孔径等に関す る常数である。

(4) 軸外色収差の補償⁽¹⁸⁾

2箇又は2箇以上の組合せから成る電子レンズ系の合 成軸外色収差係数は,各レンズの倍率及び回転色収差係 数のベクトル和である。倍率色収差係数の励磁の強さの 加減によつて正, 負, 0とすることが可能であり, 回転 色収差係数はレンズの励磁極性を反対にすれば打消すこ とができ,中間レンズを倍率縮小に使えば倍率色収差係 数が正になることから,設計と使用条件を適当にすれば 軸外色収差の完全補償が可能である。例えば第7図の特 性をもつ対物投射二レンズ系に於て, 両レンズの倍率色 収差0なる条件の組合せでは各色収差係数は第1表(次 頁参照)に示すようになる。即ち合成軸外色収差係数 CFmr は, 励磁極性逆の場合 0.12, 同方向の場合 2.24 である。普通の二レンズ系では軸外色収差係数は 1.2~ 1.6 程度(逆極性励磁)であるから約 1/10 に減少できる。 第8図(次頁参照)は第1表の2つの組合せレンズに対 して, 電圧変動 4ø/ø=6.3×10-2 を加えた場合の写真で あるが, 励磁極性が逆の場合は殆ど像のずれはみとめら れない。

633

Magnification is Zero)

には対物レンズの倍率色収差係数はレンズの弱いとき -1 で、強くなるに従つて0を通り正になることが述⁽¹⁶⁾ べられ、他の箇所で軌道方程式より係数を求め前の箇所 で述べたものに相当するようにいつて⁽¹⁷⁾いるが、その係 数 C_1 はレンズの弱いとき0 に近づき、この点では彼等 は誤つている。森戸氏は写像の主電子線を考え、物面に 於ける主電子線の傾きを考慮し、(4)式の磁場と $Z \rightarrow -\infty$ で軸に平行な主電子線を仮定して

$$(C_{Fm})_0 = -\frac{\pi(w^2 - 1)\cos w\pi}{2w^2\sin w\pi}..........(8)$$

を得た。この式は実験と大体一致し、レンズの弱いとき -1 に近づき、Zworykin らの C_1 とは物理的意味が異 なる。

投射レンズの倍率色収差に就いては焦点距離の変化か ら求めても,軌道方程式から求めても同じ結果になり, (4)式の仮定の下で

$$(C_{Fm})_p = \frac{(w_p^2 - 1)(1 - w_p \pi \cot w_p \pi)}{2w_p^2} \dots (9)$$

となる。第4図及び第5図は(7)~(9)式による計算結 果である。

中間レンズの倍率色収差に就いては余り報告されてい ない。対物レンズと同様の考察から中間レンズ単独の倍 率色収差係数を求めることができ,実験ともよい一致を 示す。結果のみ示せば係数(*C_{Fm}*)*i* は中間レンズによる



Chromatic Field Aberration of the Compensated Instrument

55	

634	昭	和	29	年3月	ar - 9 - 1	日立言	平 論	第 36 巻	第3号
			第 Ta	1 表 able 1.	第8図の Chromatic	実験の色 Aberration Coef	収差係数 ficient for the E	xperiment, Fig.8	
	* 1 * 1 *				IN/V_{ϕ}	軸上色收差係数 CFa	倍率色收差係数 CFm	回転色收差係数 CFr	合成郫外色收差係数 CFmr
対 投 合	物 射	レ レ	ンン	ズ ズ 成	18.3 14.0	1.0 mm	0 0	1.06 1.18 0.12* (2.24†)	0.12*
実実	験	(第 (第	18 🗵 18 🖻	(] a) (] b)					2.24† 0.12*

(註) * 逆極性励磁 † 同極性励磁



(a) 対物投射両レンズ同極性,合成軸外色收差係数 2.24



(b) 対物投射両レンズ逆極性,合成軸外色收差係数 0.12

第8図 軸上色收差係数と像の動き高圧電源の変動 Δφ/φ=6.3×10⁻² Fig.8. Displacement of Carbon Black Image due to Chromatic Field Aberration (Fluctuation in Accelerating Voltage Δφ/φ=6.3×10⁻²)

(5) 色収差補償レンズ系の球面収差

既に述べたように色収差補償レンズ系では、対物レン ズの倍率色収差が0に近い励磁アンペア巻数で動作して おり、 $IN/\sqrt{\phi}$ は凡そ19である。これに対し従来の電 子顕微鏡は $IN/\sqrt{\phi}$ が8~12に設計されているから、 球面収差係数 C_0 は 3~5 mm であつて、新しいレンズ 系の $C_0=1$ mm にくらべて 3~5 倍大きい。球面収差 の少ないということは色収差補償レンズ系の大きい特長 になつている。第9 図は励磁の強さ $IN/\sqrt{\phi}$ と球面収 差係数の関係を示したものである。

(6) 試料前磁場の検討⁽¹⁹⁾

色収差補償対物レンズは強励磁で使うために試料をレ ンズ磁場内に深く挿入せねばならないがそうすると試料 前磁場が強くなりその影響で照射角が大きくなつて解像 度を下げるおそれがある。これまでも前磁場による解像 度の低下に就いては多くの発表があり, $IN/\sqrt{\phi} < 10$ で なければならないという悪影響過大視説もあつて納得す ることができなかつたが, 森戸氏は計算によつて詳しい 検討を行い次の結果を得た。

(1) 軸上照射角に就いては試料前磁場の影響は,試

56	





D

実験からいえることで、軸外の試料点であること自身に よる悪影響は他の収差面から当然存在し、試料による散 乱もあるので、実験的に前磁場に基づく好影響は確めら れていない。しかし従来の説のように強励磁のための前 磁場によつて解像度が低下するということにはならな い。

635

[III] HU-9型電子顕微鏡

HU-9 型電子顕微鏡は, 像拡大レンズの設計基礎を色 収差補償法におき,多能化の面から3段レンズとし, 投 射レンズの Revolver を活用して高分解能電子廻折法も 実施できるように設計した。即ち

- (1) 色収差補償レンズ系で高圧電源に対する安定度 の負担を軽減し,併せて対物レンズのコントラスト 絞りの交換を容易にして厚い試料の観察を容易なら しめた。
- (2) 3段レンズとして,電子顕微鏡試料位置に於ける全視野又は制限視野に対応する廻折像が得られる。
- (3) 投射レンズの倍率を変えるのに Revolver 方式 を用い更に中間レンズを仂かせて, 色収差補償条件



第10図 試 料 前 磁 物 の 影 響 図 Fig.10. Field Effect for Illuminating Beam

- 料をレンズ内に深く挿入した場合(*IN*/√ = 20 ぐ らい)でも小さく,実用的には問題はない。
- (2) 軸外の電子線に対しては、その傾きを大きくは するが照射角の増加は軸上の場合と同様に小さい。 このことは強励磁の状態で軸より数µ離れた物点の 周りにも数本のフレネルフリンヂが出ていることか らも裏書きされる。
- (3) レンズの球面収差を考えれば写像に関与する電子線が、レンズ内を軸附近で通るほど球面収差による像の劣化は少くなる筈である。ところが計算結果によれば前磁場は一般に第10図に示すように照射電子線束がレンズ内を軸附近で通るように作用するので前磁場は悪影響どころか好影響を及ぼすこともあり得る。
- 以上のことは照射角の計算結果とフレネルフリンデの

を満足しながら 800~15,000 の広範囲に連続変倍とした。

- (4) 中間レンズと投射レンズの間に電子廻折部を設 け廻折アダプタを常備し,高分解能可変分散電子廻 折,K-M 廻折,陰影顕微廻折(Hillier 廻折),陰 影顕微鏡の4種に使える。
- (5) 電子廻折部には,必要に応じ,試料加熱装置, スプレーガン(電荷中和用)を取付け得る。
- (6) 暗視野像の撮影ができる。
- (7) 据付調整後は鏡体の解体を不必要とするため,
- コンデンサレンズ絞り,対物レンズ絞り,視野制限 絞りは電子線を出したま、で中心合せが外部からで き,絞りの大きさも大中小の3段に変えられる。
- (8) 多数枚撮りカメラを考案し,撮影能率を著しく上げた。
- (9) 排気系統を新しく設計し, 排気速度を上げ誤動 作がない。
- (10) 高圧電源部は防電撃構造とし,安全装置を附し た。

等である。第11図(次頁参照)は全装置の写真,第12図 (次頁参照)は鏡体断面図である。以下各部の構造特長に 就いて略述する。

(1) 電子光学系

電子顕微鏡のみでは物質の形態は知り得ても内部構造 (原子配列)は明らかにし得ないので、物質が何であるか

— 57 —



を決めることは難かしく,このため最近電子 廻折の方法 が併用されるようになつた。また電子廻折法は電子顕微 鏡製作技術の進歩によつて分解能が高まり, 廻折像の異 常が容易に観測されるようになつて,それらの或るもの は試料の大きさ、外形によるものであることが判り、電 子顕微鏡による観察が解析の助けになつている。

HU-9型電子顕微鏡の設計に当つては、電子顕微鏡と 電子 廻折との 緊密な結合を 企画し,以下に述べる 如き多 性能を発揮出来ること」なつた。

(A) 明視野法〔第13図(1),(2)〕

第13図(1)は中間レンズを切り対物レンズと投射レン ズを動作させ軸外色収差完全補償の条件で使用するもの である。高い解像度の写真をとる場合はこのレンズ組合 せが最も良い。

第13図(2)は倍率を広範囲に変える必要のある場合の 使用法で,中間レンズと投射レンズの励磁電流を,定め られた関係に於て変化し, 倍率の変化にかいわらず軸外 色収差を小さく保つようにしてある。この場合中間レン ズは倍率縮小に用いている。

第12図 HU-9型 電子 顕 微 鏡 鏡 体 Fig.12. Section of Principal Parts of the Type HU-9 Hitachi Electron Microscope

(B) 暗視野法〔第13図(3)〕

暗視野法は主電子ビームをストップし試料からの散乱 電子のみで結像させるもので,明視野法では観察し難い 厚い試料の内部構造や結晶試料の観察に適している。 HU-9型電子顕微鏡では、対物レンズに対して入射電子 線の方向を傾ける方法,対物レンズコントラスト絞りを 中心から外す法,対物投射面レンズの軸をずらせる法の 何れによつても暗視野像が得られるが、後述の如く操作 の難易,像の質にかなりの差がある。

(C) 制限視野廻折法 [第13図(4),(5)]

第13図(4)の如く、対物レンズによる試料の拡大像を 中間投射面レンズで拡大すると電子顕微鏡像が得られ, 第13図(5)の如く対物レンズ後焦面の小さな廻折像を中 間レンズで投射レンズの前に作るとこれが拡大されて廻 折像が観察される。このとき中間レンズの前焦面附近で

---- 58 -----



637

試料像を視野制限絞りによつて制限すると螢光板上の像 も制限され廻折像に切り換えたとき,その部分のみの廻 折像が現われる。この方法を制限視野廻折法とよんでい る。なお廻折えの切換えに当つては対物レンズのコント ラスト絞りを取除き,視野制限絞りで所望の試料像を捕 えるのであるが HU-9 型電子顕微鏡では外部から容易 に操作できる。

(D) 高分解能廻折法 〔第13図 (6)]

この場合は電子源のクロスオーバーの像をコンデンサ レンズ及び対物レンズで縮小し,その縮小像を中間レン ズによつて乾板上に結ぶもので,試料は中間レンズと投 射レンズの間に置かれている。更に第13図(7)の如く投 射レンズを仂かせればカメラ長を変えることもできる。 高分解能廻折像を得るためには高圧電源,レンズ電源に 電子顕微鏡と同程度の安定を要求するが,この機械の性 質上全然問題はない。

---- 59 -----

(E) 陰影顕微鏡廻折法 [第13図 (8)]

Hillier 廻折法ともよばれるもので,試料で Bragg 反 射が起つていると像の中央に明視野像が,絞りの影のま わりに試料の形に対応する暗視野像が現われる。この像 は試料の面指数を決めるのに有用である。中間レンズは 第13図(7)の場合よりも少しく強く仂かせるだけである。

(F) 陰影顕微鏡法 [第13図 (9)]

第13図(8)の場合より中間レンズを更に強くして全視野に明視野像を出すものである。

(G) K-M 廻 折 法 〔第13図 (10)]

中間レンズにより試料上に焦点を結ばせると(照射範囲は数十~数百mµ)収歛電子線の廻折像が観測される。 これを K-M 像という。廻折像は絞りの形になるが試料がかなり厚い(マイカで900Å)と第13図(10)のように廻 折線が現われて副極大を伴い,これより結晶の内部電位が求められる。

(2) 電子照射系

高性能電子顕微鏡の試料照射系は,電子銃と単一又は 二重コンデンサレンズから成つているが,要は試料照射 の開き角が小さく,しかも照射面積が小さく且つ加減で きるものが望まいし。HU-9型電子顕微鏡の電子銃は,



フイラメントの芯出しを容易としたほかは従来のものと 大きな差異はない。コンデンサレンズの絞りには3箇の 異なる孔径のものが挿入されており、必要に応じて電子 線を出したま、絞り孔の交換中心合せができるようにし た(第12図コンデンサレンズ部参照)。

(3) 試料室

特に試料微動が円滑であることム振動による像障害除 去を目標として従来の試料室に改造を加えた。両者を同 時に満足させることは難かしかつたが,第14図の吊篭式 微動装置と特殊設計の試料保持器により或る程度目的を 達した。第15図は電子顕微鏡キャビネットの卓上(カメ ラ室の横)にハンドドリルをおいて廻したまム撮影した 写真であるが,振動による像の動きは殆どみとめられな い。そのため除振士台は不用となり設置場所の制限がら くになつた。

対物レンズの焦点距離は屢々変える必要がある。たと えばコントラストのつき難いヴイールス等に対しては長 焦点レンズとして小さい孔の絞りを使う方がよいし,制 限視野廻折に対しては試料の廻折角の広がりに応じて焦 点距離を変えねばならない。幸いこの試料室は試料面を 光軸上の任意の位置に止められる構造になつているので 上に述べた焦点距離の調節は可能であるが,別に長さの 異なる試料トレーガーも附属している。

(4) 対物レンズ

対物レンズは色収差補償条件を満足させるため最大励



- 第15図 HU-9型の耐振性 キャビネット卓上でハンド電気ドリルを 廻して振動をさせながら撮影した
- Fig.15. Vibration Proof Property of the Type HU-9 Electron Microscope



- 第16図 強いレンズで用いた時非点収差の小さい ことを示す過焦点像のフリンヂ 試料カーボンブラック
- Fig. 16. Overfocused Contour Fringe of Carbon Black Obtained with a Strong Objective Field (Very Small Astigmatic Aberration)

磁では IN/√ ζ = 20 ぐらいまで使えるように設計して あつて,従来のコイルよりもかなり大きい。しかし必要 によつては弱励磁でも使うことがあり,レンズスタビラ



イザの電流可変範囲を広くとつてある。

対物レンズを強励磁で使う利点の一つは,非点収差が 著しく小さくなることである。その理由はレンズ磁極素 材に残存する磁気的異方性の減少と考えられる。第16図 にカーボンブラックを高倍率で撮つた場合の過焦点フリ ンヂを示す。

電子顕微鏡の使用中,試料の性質によつてコントラス ト絞りの孔径を変えたいことや,制限視野廻折では外部 廻折環がコントラスト絞りに遮られないために,大きい 絞りと取かえる必要が起る。HU-9 型電子顕微鏡では対 物レンズの絞りはコイルの側面から真空パッキングを通 してレンズ磁極の下面に挿入する構造になつており,同 時に大,中,小3 箇の絞りを保持できる。そのため像を出 したまゝで外部から絞り孔の交換と中心合せができ,試 料に応じて適当な絞り孔径のものを選択使用することが 可能となつた。絞り孔の交換に要する時間は僅か 10 sec である。なお絞り板には厚さ 0.05~0.1 mm の白金板を 用いている。

(5) 中間レンズ及び高分解能電子廻折装置

中間レンズを倍率縮小レンズに使つた場合,倍率色収 差係数 $(C_{Fm})_i$ は常に正で,(10) 式から判るように倍 率縮小率1のとき $(C_{Fm})_i = 0$, 0.5 のとき $(C_{Fm})_i = 1$, 0.33 のとき $(C_{Fm})_i = 2$ である。回転色収差係数は励磁 アンペア巻数の増加(縮小率の減少)に比例して増す。 投射レンズの励磁電流を減じて倍率を下げると,投射レ

Fig. 17. Intermediate Lens Part and Diffraction Specimen Chamber

ンズの回転色収差係数は小さくなり,倍率色収差係数は 負符号で絶対値を増すから,これと中間レンズを適当に 加えて軸外色収差係数の総和を極小に保ちながら,かな りの範囲に亘つて綜合倍率を変えることができた。

制限視野廻折を行う場合,中間レンズの非点収差や球 面収差が輝点の大きさに影響するので,精密に工作され た大きい孔径のレンズを用い,電子光学的に対物投射両 レンズに対して軸合せを行つて,レンズの中心部のみを 利用するようにしなければならない。そのため対物投射 両レンズと関係なく,中間レンズのみを動かす方向調整 装置を設けてある(**第17図**参照)。

中間レンズと投射レンズとの間に高性能電子廻折室が 設けてある。廻折室には中間像覗窓,中間像螢光板及び 排気抜口の他に,アダプター取付口が4箇あり,普通は 栓をしてあるが,必要に応じて透過反射両用の廻折アダ プター,試料加熱装置,スプレーガン等を取付けられる ようになつている。

(6) 投射レンズ

投射レンズは軸外色収差補償のため,アンペア巻数は 倍率極大(倍率色収差0)となし得る如く設計され,同 時に回転色収差も補償されるよう磁極孔径と間隔の比を 適当に選んである。投射レンズのこのような使いかたで は,対物レンズと組合せたとき倍率は固定するので,倍

--- 61 ----

日 立 評 論

第36巻第3号



第18図 投射 レンズ部 Fig.18. Projector Part (Revolver)

率範囲を拡大するために,中間レンズの併用と孔径間隔 の異なる多数の投射レンズを用いなくてはならない。 HU-9 型電子顕微鏡では4箇のレンズを Revolver 式に 交換する構造とした。

Revolver の構造は第18図に示す如く,つまみを廻す と傘歯車の咬み合いを通して次々に倍率の異なる投射レ ンズが光軸上に出て来る。正確に工作されたストッパー があり常に投射レンズ磁極は光軸上で止るようになつて いる。





(7) カメラボツクス

像の観察には明るい視野を楽に覗いて正しくピント合 せができ,高能率撮影の可能なカメラボックスを設計し た。

螢光板は 55×60 mm 角で水平に対し 30°の角度で 斜めに立つており,両眼で 2.5 倍の拡大鏡を通して全視 野を観察することができる。ピント合せの場合は 10 倍 のルーペが附属しているので極めて正確に合せられる。

レンズ類はすべて無反射処理を施して視野の明るさの 減少を防いでいる。また正面の主視窓の他に両側にも別 の視窓を設けて多人数の観察を便にした。電子廻折の場 合主スポットの遮断にスプーンを取付けてある。

カメラ室は高能率撮影を実現するため従来の方式をや めて**第19図**の如き多数枚撮影用カメラを考案設計した。 これによりキャビネ 1/3 截 18 枚(乾板1枚の大きさ 120×50 mm, 50×50 mm 36 駒, 50×20 mm 72 駒)同 時に装架でき,連続撮影も,また途中で露出ずみの乾板 を任意枚数だけ像を出したまゝで取出して現像すること もできる。

(8) 真空排気系

従来の高真空排気系が,排気抵抗と誤操作の立場から みて,かなり不合理に作られていたことは否めない。排 気抵抗の主なものは,排気管の抵抗とバルブの開きの足

$V_1 \sim$	$-V_4:$	バル	ブ	D:	乾焇	育剤	「室
	P_1 :	油拡散ポ	ンプ	H:	高真	空非	非気
P_2	$-P_3$:	油廻転ポ	ンプ	s:	試料	室主	非気
	M:	鏡	体	C:	カメ	ラ室	排気
	A:	モ -	タ	P:	乾板	予備	排気
	B:	真空夕	ンク	A:	IJ	-	7
	C:	乾板予備	排気室	St:	停		Ш:
	L:	低真空	排気				
第20図	真	空	排	気	采	•	統
Fig. 20.	Sch	ematic	Diag	ram	of t	he	Vacuum

System

りないことにあるが、HU-9 型電子顕微鏡に於ては、バ ルブを新しく設計し、拡散ポンプを鏡体に近づけて排気 速度の増大を図つた。第20図に綜合排気系統を示した。 従来の主バルブはベローの伸縮を利用したもので、バ ルブのストロークを大きくするのに設計上無理があつた ムめ、今回は第21図の如き回転開閉方式を採用し、低真 空側の切換バルブにはカム溝で3箇のバルブが動作する 星形バルブを作つた。主バルブと星形バルブとは、クラ ンクとカムによつて連結して誤動作を防いだ。排気所要 時間は、鏡体大気圧から使用可能まで20min、又試料交 換 30 sec, 乾板取出し 30 sec 程度である。



D.P.: 油拡散ポンプ H: 高真空排気 R.P.: 油回転ポンプ L: 低真空排気 第21図 主バルブ, 星型バルブとの連動機構 Fig.21. Main Valve, Star Type Valve and their Connection

(9) 電 源

HU-9型電子顕微鏡の電源は次のことを主眼として設 計した。

- (1) 周波数補償付の電圧安定装置によつて電源周波 数変化による安定度低下の不安を除いた。
- (2) 点検を容易にし、配線や結線がよく判るように



補償電圧安定装置を取付けた。

高圧の安定は、高圧トランスの一次側で行うものでト ランスダクタとフィードバック増幅回路から成り、従来 の方法と大差ない。高圧電源は全面的に設計変更を加え て第23図の如く同一タンク内に、高圧トランス、ケノト ロン、ケノトロンフイラメントトランス、電子顕微鏡フ

641

した。

- (3) 電子レンズの軸合せのために電子加速電源に交流電圧を附加重畳せしめた。
- (4) 操作を容易にし、安全と保護に万全を期した。
- (5) 入力電圧は 100V, 200V 両用とした。

第22図に綜合配線図を示す。入力側には単巻変圧器を おき、電圧の粗調整を行うようにした。また電源周波数 の変化による出力電圧の変動を無くする目的で、周波数 イラメント加熱トランス,安全抵抗,グリッドバイアス 抵抗等すべて油浸として納め,バイアス抵抗はタンク外 よりハンドルで調整でき,又自動放電装置を併用した。 高圧及びフイラメント加熱トランスの引出しは3芯レン トゲンゴムケーブルとした。そのため防電撃構造とな り,容積は小さくなつた。即ち発生電圧 50 kV で,た て 300 mm,よこ 600 mm,高さ 700 mm となり,第 24図(次頁参照)はその外観である。



第22 図 綜 合 配 線 系 統 図 Fig.22. Complete Circuit

---- 63 -----



らない。電流中心はレンズ励磁電流の極性を切りかえた り電流を増減して合せているが、電圧中心の出しかたは 極めて面倒であった。HU-9型電子顕微鏡に於ては第23 図の如く高圧コンデンサの接地側を絶縁して小型変圧器 を挿入し、一次側より電圧を加えて数百ボルトの交流を 直流高圧に附加重畳し,大きい電圧変動を与えてそれに よる像の動きから電圧中心を見出す方法をとつた。

配線の点検を容易にするため, 配線をすべて配電盤に 集め,開放容易な構造のケースに納めた。

[IV] HU-9型電子顕微鏡の性能

(1) 明視野像の倍率と分解能

Revolver 式投射レンズと中間レンズにより,直接倍 率を×800~×15,000 まで広範囲に連続に変えられ,そ の間すべて軸外色収差係数は 0.3 以内(普通 1~2)にお さえられている。とくに ×2,500, ×5,000, ×10,000 及 び×15,000の各倍率に於ては軸外色収差は完全に近く 補償されている。終像焦点合せの場合は ×10 の顕微鏡







Fig.25. Circuit Diagram for Current Stabilizer

レンズ励磁電源も従来の装置と大差なく,第25図の如 き単純逆再生方式を採用した。電源の安定度は, 凡そ高 圧 0.01%, 対物レンズ及び投射レンズ 0.01%, 中間レン ズ 0.01%, コンデンサレンズ 0.05% である。

電子顕微鏡の調整には電圧中心, 電流中心が同一視野 内にあることが望ましく, とくに色収差補償電子顕微鏡 では電圧中心が螢光板の中央にあるように調整せねばな



 $\times 420,000$ (a) ジョジアカオリン,角の鈍化よリ測定



- 金コロイド2粒子間の見分け得る間隔より測定 (b) HU-9型 電子顕微鏡の解像度を示す写真 第26 図
- Micrograph Representing the Resolu-Fig. 26. tion of the Type HU-9 Electron Microscope

- 64 -----



(a) $\Delta \phi / \phi = 0.01\%$



(b) $\Delta \phi / \phi = 0.2\%$





643

(a) 色収差補償



(b) 普通レンズ

(c) $\Delta \phi / \phi = 1.0\%$

第27図 高圧変動と解像度の低下を示す写真 (カーボンブラックとコロイド)

Fig. 27. Micrograph for Relation between the Fluctuation in Accelerating Voltage and Resolution

(Carbon Black and Colloid)

で拡大しているので,最高 150,000 倍の像が肉眼で観察 できる。終像の明るさはコンデンサレンズの強さや対物 レンズ絞りの大きさで異なるが最高倍率でもらくに見ら れる。

分解能は測定のしかたで種々の値を示すが, 我々はカ オリンの如く鋭角をもつ微粉末試料の角の鈍化と, 金コ ロイド粒子の分解し得る二点間の距離の2方法で測つて みた。その結果角の鈍化からは 2.5 mµ, 2 物点間の距離 からは 2 mµ の値が得られ, 2~3 mµ の分解能を示し た。第26図(a)(b) はその写真である。 第28図 黄色ブドウ状球菌の観察 (電圧 50 kV, 寒天培養 24 hr) Fig.28. Micrograph of Staphylococcus

高圧電源が変動すれば解像度が低下することは周知の 通りであるが、HU-9型電子顕微鏡に於ては色収差を補 償しているため普通型にくらべて像障害の程度は著しく 緩和されている。第27図ばコロヂオン膜上にカーボンブ ラックを分散させた試料の電子顕微鏡写真である。電圧 変動の与えかたは、安定化された高圧電源の接地側から 交流を重畳する方法をとつた。第27図(a)は $4\phi/\phi=$ 0.01%、(b)は $4\phi/\phi=0.2\%$ 、(c)は $4\phi/\phi=1\%$ の場合 であつて、 $4\phi/\phi=1\%$ の大きい変動(従来の 100 倍)に 於てさえ、全視野に亘つて数十 mµの解像度(同じ条件 で Le Poole は 8 mµ)をもち期待に近い写真が得られ ている。

(2) 明視野像のコントラスト調整

HU-9 型電子顕微鏡で対物レンズ絞りの孔径を大きく すると普通レンズの電子顕微鏡像にくらべて厚い試料の 内部構造がよく観察されることが多い。第28図及び第29 図(次頁参照)はその一例である。

既に述べたように色収差補償の対物レンズは強レンズ を使つているので軸上色収差と球面収差は普通レンズに くらべて著しく小さく,軸外色収差は殆ど0である。厚 い試料の像が良くみえるのは,色収差が小さいためであ

_____ 65 _____



Fig. 30. Dark Field Image of Carbon Black

--- 66 ----

1 - A REPARTMENT OF A REPORT

and a state of the second seco

るとする説と, 色収差と球面収差が或る励磁条件で補正 する所謂スフエロアクロマチゼーションによる説とがあ り, 問題は今後に残されている。

ヴイールスや高分子微粒子の如くコントラストのつき 難い試料に対しては試料を上げて対物レンズの焦点距離 を長くし,対物レンズの絞り孔を小さいものと交換して コントラストを上げるようにする。絞り孔の交換は 10 sec ぐらいでできるのでコントラスト調整は容易であ る。

(3) 暗視野像

既に述べたように HU-9 型電子顕微鏡による暗視野像 は3種の異なる方法で行えるが,像の質からは入射電子 線を傾斜させる方法が,また操作の容易さからは対物レ ンズ絞りの中心を外す方法が優れている。後者は絞り孔 径を小さくし(20µ位)絞りを光軸から外し過ぎないよ うにしなければならない。このような注意を払つても粒 子像の縁のかゞやきは第30図(a)の如く対称を欠いてい る。その主因は球面収差よりもむしろ色収差によるもの と考えている。対物レンズと投射レンズの軸をずらして 撮つた暗視野像にはこのような現象はなく第30図(b)の 如く美しい写真が得られる。

(4) 制限視野廻折

第31図は MgO 結晶の制限視野廻折像(a) とそれに 対応する廻折像(b) である。(c) 図は(b) 図の一部を 拡大したものであるが電子線の複屈折効果による斑点の 分裂がみられる。(d) 図は(c) 図の矢印(1)の斑点を対



646	昭和29年3月	日	<u>M</u> :	評	論	第36巻	第3号
1 <u></u>		1000					사람이 가격 관람들

第2表制限視野廻折の分解能指数 Table 2. Resolvtng Index of Bcerch's Electron Diffraction

カメラ長 (mm)	乾板上のスポツトサイズ (mm)	分	解	能	指	数
350	0.06	1.7×10-4				
495	0.1		2.	0×1	0-4	
1,700	0.3		1.	8×1	0-1	

物レンズ絞りで拾つて暗視野像としてみたもので, 矢印の斑点は MgO の [220] 面からの廻折であることが知られる。

制限視野廻折の場合の分解能指数(resolving index) は次のようにして求めた。即ち廻折像を撮るときと同じ レンズ動作条件で中間レンズにより乾板の上に正しく焦 点を結び,乾板を動かして線を画かせその太さをミクロ ホトメータで測つてカメラ長で割り分解能指数とした。

実験結果は**第2表**の通りであって,カメラ長 350~ 1,700 mm の範囲で,分解能指数は 2×10⁻⁴ よりも幾分 よいということが判つた。この場合コンデンサレンズの 強さを変えると指数はかなり変り,電子源のクロスオー バのスポットサイズを小さくすれば 1×10⁻⁴ ぐらいまで ンズを使うと 0~2,000 mm の範囲に変えられる。分解 能を左右する乾板上のスポットサイズは制限視野絞りの 汚れの影響と焦点合せの良否にかなり敏感であるが、注 意して使えば $3~4\mu$ の太さまで縮小することができる。 従つて投射レンズ無しのときの分解能指数は約 1×10^{-5} である。第32図に酸化亜鉛の高分解能廻折像を示した。

(6) 陰影顕微鏡廻折及び K-M 廻折

第33図及び第34図はこの装置で得られた陰影顕微鏡廻 折像及び K-M 廻折像である。このほかこゝには例示し なかつたが陰影顕微鏡像も容易に得られる。

〔V〕 結 言

HU-9 型電子顕微鏡は,日立に於ける色収差補償レン ズ系の研究に基礎をおき,多能化の面では最近の電子廻 折装置の知識をとり入れ,電源,真空排気系,鏡体等は 大部分新考案になるものを具体化したものである。本文 の要旨を総括すると次の如くである。

(1) 磁界レンズの色収差補償法を確立するに至るま での歴史的背景に就いて述べ,その原理,実験,理 論を詳論した。

(2) 色収差補償法を実現した HU-9型電子顕微鏡の

改善し得る。

(5) 高分解能廻折

HU-9 型電子顕微鏡では高分解能廻折に投射レンズを 用いない場合,カメラ長は 350 mm であるが,投射レ 設計目標に就いて述べ,投射レンズに Revolver を 使い,中間レンズと投射レンズの間に電子廻折室を 設けたことから,電子光学的に約 10 種に使える。 (3) 更に鏡体設計,電源,排気系に就いて述べ,と





第33図 天然マイカの陰影顕微廻折像 Fig.33. Shadow Microscopic Diffraction Pattern of Mica

第34図 天然マイカの K-M 廻折像 Fig.34. K.M. Diffraction Pattern of Mica



くに高能率化のため多数枚撮影カメラボックスを新 たに設計した。

 (4) 最後に,本電子顕微鏡の使用例を示したが,電子顕微鏡像の分解能 2~3 mµ,制限視野廻折の分解 能指数 2×10⁻⁴,高分解能電子廻折の分解能指数 1×10⁻⁵,カメラ長 0~2,000 mm であることを実験 から求めた。

HU-9 型電子顕微鏡は,既に数台受注決定し鋭意製作 中であるが,この機会にその概要を述べ諸賢の御批判を 仰ぐ次第である。

終りに臨み,HU-9型電子顕微鏡の研究製作に際し, 多大の御指導と御援助を賜つた日立製作所中央研究所長 菊田多利男博士,浜田秀則博士,第4研究室森戸主任は じめ研究室の方々,多賀工場平木工場長,木内計器部長, 牧野精器課長はじめ精器課電子顕微鏡設計関係の方々, 検査部その他関係各位に対し深くお礼申し上げる。

參 考 文 献

- (1) V.K. Zworykin et al: Electron Optics and the Electron Microscope, John Wiley and Sons Inc, (N.Y.) 1950, p. 214
 電源の許容変動, 高圧≤1.1×10⁻⁴, 対物レンズ電流≤0.55×10⁻⁴, 投射レンズ電流≤1.3×10⁻⁴
 (2) Ref (2) pp. 210~213
- (3) 片桐信二郎: 電顕学誌 3 25 (1953), 但し分解能

の測定はミクロホトメータ及び Ardenne 法による。

- (4) J.P. Le Poole: Netherlands-Delft, 片桐信二
 郎及び森戸望の電子レンズ色收差補償に関する論
 文に対する批判私信 (5th Nov., 1953)
 - (5) Glaser の仮定したベル型で対物レンズの磁界分 布を近似すると倍率色收差係数の0となる $IN/\sqrt{\phi}$ は約 19 となる。普通レンズは $IN/\sqrt{\phi}$ が 8~12 で使われている。
 - (6) 例えば,

金谷光一: 電頭委 50-A-8 (1949) 井上彌二郎: 電頭委 56-A-6 (1951) 金谷光一: 電試彙報 15 646~655 (1951)

- (7) 伊藤一夫: 電顕委 55-A-10 (1950)
 試料前方磁場を考えると IN/√φ<10 でなければならない。普通はこの条件を満足しているといっている。
- (8) 森戸望: 第7回電顕学会講演 No. 41 (1952)
- (9) 片桐信二郎,只野文哉: 特許出願公告 昭 27 5225,5226 単独及び二箇以上のレンズによる色
 收差補償(出願 1951-3)

片桐信二郎: 第18回電顕学会講演 (1952, 名大)

(10) 只野文哉,片桐信二郎,森戸望: 特許出願公告 昭 28-571 中間レンズを縮小レンズとして使うレ ンズ系色收差補償(出願 1951-5)

____ 69 ____

648	昭和29年3月 日 立	評	論 第36巻第3号
	森戸望: 電顕学会シンポジウム講演集 27~29	(15)	W. Glaser: Z.f. physik 117 285~315 (1941)
	(1953)		金谷光一他: 第9回電顕学会講演 (1953)
(11)	B. v. Borries: Übermikroskopie 第 53 図		伊藤一夫他: 第6回電顕学会講演 (1951)
	(1950)		森 戸 望: 第8回電顕学会講演 (1952)
(12)	O. Scherzer: Z. f. physik, 101 593~603		森 戸 望: 電顕学会シンポジウム講演集
	(1936)		27~29 (1953)
(13)	金谷光一他: 電試彙報 15 257~263 (1951)	(16)	Ref. (2) pp. 210~213
	片桐信二郎: J. Electron Microscopy 1 13~	(17)	Ref. (2) pp. 570~575
	18 (1953)	(18)	Ref. (14)
(14)	片桐信二郎: 第8回電顕学会講演 (1952-名大)	(19)	Ref. (8)
	比損信一郎・ 電話学社 3 21~20 (1053)		



実用新案 第403440号

小 沼 武 男

電 子 顕 微 鏡

電子顕微鏡に於ては,陽極1は筒体2を介して接地せられているのに対して,陰極ヒラメント3及びウエネルト円筒4は50,000 V程度の負電位が印加せられている。 従つて筒体2を排気しこれを高真空となすと曲率半径の放さいリード線5よりは極めて容易に蓋6又は筒体2に小電して,電子顕微鏡の作動が不安定となる。これの対策としてはリード線を大径となすことが考えられるが,可撓性を犠牲としなければならない。

本案はこの点に鑑みウエーネルト円筒4の上部を被う 金属板製中空の略半球状のカバー7を載置したものであ るから,このカバーによつて上記放電を抑え簡単な構造 により従来の欠点を除き得たものである。

(田中)



---- 70 -----